

韓国知的財産ニュース 2019年8月前期

(No. 396)

発行年月日：2019年8月20日

発行：ジェトロソウル事務所 知的財産チーム

<https://www.jetro.go.jp/korea-ip>

★★★目次★★★

このニュースは、8月1日から15日までの韓国知的財産ニュース等をまとめたものです。

法律、制度関連

- 1-1 特許法一部改正法律案
- 1-2 「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令（案）立法予告

関係機関の動き

- 2-1 特許庁、「知的財産学」単位銀行制度2学期受講生を募集
- 2-2 大韓弁理士会、「半導体素材技術の国産化」特許戦略策定へ
- 2-3 特許庁、「知的財産基盤次世代英才企業家」10周年記念式典開催
- 2-4 強い知的財産の創出、私たちに任せてください！
- 2-5 イノベーション成長の達成に向けて革新的特許の発掘、アイデア取引の支援など
- 2-6 特許庁長、半導体装備の核心部品製造企業を訪問
- 2-7 素材部品特許という「地雷」を伏せている日本、IP R&D 戦略で対応を

模倣品関連および知的財産権紛争

※今号はありません。

デザイン（意匠）、商標動向

- 4-1 デザイン登録出願の取り下げの場合、秘密デザイン請求料、出願公開申請料も払い戻される

その他一般

- 5-1 消費者の嗜好に合わせて進化するカプセルコーヒー
- 5-2 研究開発支援の拡大・特許技術の活用が微細粉塵の解決の鍵
- 5-3 未来自動車の核心、AIカメラ技術

法律、制度関連

1-1 特許法一部改正法律案

議案情報システム (2019.8.5)

特許法一部改正法律案

議案番号：21841

提案日：2019年8月5日

提案者：民主平和党 チョウ・ベスク（趙培淑）議員外9人

<提案理由および主要内容>

現行法では、特許要件の一つとして産業上の利用可能性を挙げている。判例と特許庁の例規である「特許・実用新案審査基準」では医療行為に対する発明は、現行法上の特許要件である産業上の利用可能性がないという点を根拠に特許の対象から除外している。

しかし、最近、医療分野の産業化が進み、医療行為の特許可能の有無を産業上の利用可能性という問題として取り扱うのは論理性に欠けるため、医療行為の特許性の有無を法律に明示する必要がある。

また、最近、シェアリングエコノミーの発展に伴い、特許権者が通常の実施料より少ない補償金を受領しながら第三者に特許権の通常実施権を許諾する多衆に対する共有制度（Patent Pledge）が新しく登場している。

特許発明の共有を拡散することは、創意的な発明と技術の発展を促進する触媒になることがあるため、特許発明の共有に向けた法的根拠を新設する必要がある。

これを受けて、人体を手術・治療または診断する方法に関する発明に対しては、特許を受けることができないように法律で明確に規定する一方、特許権者が通常の実施料より少ない金額の補償金を受領する条件で第三者に通常実施権を許諾するという通知を特許庁長に行う場合、特許料を減免することができるようにする規定を新設するためである（案第32条第2項、第83条第4項から第8項まで新設）。

法律 第 号

特許法一部改正法律案

特許法の一部を次のとおり改正する。

第 32 条 題名以外の部分を第 1 項にし、同条に第 2 項を次のとおり新設する。

②人体を手術・治療又は診断（臨床的判断を含まない診断は除外する）する方法に関する発明に対しては特許を受けることができない。

第 83 条に第 4 項から第 8 項までをそれぞれ次のとおり新設する。

④特許庁長は、特許権者がその特許発明の実施に対して合理的に受けられる金額より少ない補償金を受領する条件で第三者に通常実施権を許諾するという通知を書面で行った場合は第 79 条にもかかわらず、産業通商資源部令の定めに基づいて特許料を減免する。この場合、特許権者が提示した補償金が過多であると判断する場合は、特許料を減免しないようにすることができる。

⑤特許権者は、特許権に対して専用実施権が設定された場合、第 107 条に基づく通常実施権の設定に関する財政の請求がある場合又は特許権の存続機関が 5 年未満残った場合は第 4 項に基づく通知をすることができない。

⑥特許庁長は、第 4 項に基づく通知がある場合は、産業通商資源部令の定めに基づいてこれを告示しなければならない。

⑦特許権者は、第三者が補償金を支給するという意思を表示した後は、第 4 項に基づく通知を撤回することができない。

⑧第 4 項に基づく通知の方法、補償金の支給の手続き、その他必要な事項は産業通商資源部令で定める。

附則

この法は公布後 6 ヶ月が経過した日から施行する。

産業通商資源部公告第 2019-487 号

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第 41 条」に基づき、次のとおり公告します。

2019 年 8 月 13 日

産業通商資源部長官

「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令（案）立法予告

改正理由および主要内容

産業政策を支え、技術イノベーションを支援するために、現行の特許審査の体系（特許審査企画局、特許審査 1 局、特許審査 2 局、特許審査 3 局）を、産業と連携した審査体系に全面改編（特許審査企画局、電気通信技術審査局、化学生命技術審査局、機械金属技術審査局）し、第四次産業革命時代の到来に備え、融複合技術を専担として審査する融複合技術審査局を新設し、これに必要な人員 23 名（高位公務員 1 名、3 級または 4 級 1 名、4 級 1 名、6 級 20 名）を増員する一方、特許ビッグデータを活用した技術分野別動向調査機能の総括・調整および企画に必要な人員 3 名（4 級または 5 級 1 名、5 級 2 名）と、「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」が、改正（法律第 15976 号、2018. 12. 18 公布、2019. 3. 19 施行）されたことにより、技術奪取による中小・ベンチャー企業の被害を防止するための人員 5 名（4 級または 5 級 1 名、6 級 4 名）を、それぞれ増員しつつも、政府組織運営および定員管理の成果と責任性を高めるために新設される機構と、新規で増員される人員を成果評価対象組織と定員として規定するなどの内容で「特許庁とその所属機関職制」が改正（大統領令第 0000 号、2019. 0. 0. 公布・施行）されることに伴い、変更される事項を反映させる一方、産業財産政策局内の課・チームの分掌事務を調整し、定員管理の効率化のために定員を整備するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

関係機関の動き

2-1 特許庁、「知的財産学」単位銀行制の2学期受講生を募集

韓国特許庁 (2019. 8. 5)

特許庁は、8月5日(月曜)から8月23日(金曜)までの3週間、2019年2学期の「知的財産学」単位銀行制(※)のオンラインコースの受講生を募集する。

※単位銀行制とは、教育部が認めた教育機関で単位を取得し、一定基準を満たした受講生に学士号を授与する制度

特許庁国際知識財産研修院が無料教育課程で運営する「知的財産学」の専攻コースは、高校卒業者又は同等の学歴を有する一般人であれば、誰でも参加できる。

また、特許庁と単位交流を結んだ忠南大学、全北大学、済州大学、啓明大学、仁済大学、建陽大学など計12大学の在学学生なら、単位銀行制を通じて修了した科目に対して、所属の各大学で単位を認めてもらえる。

「知的財産学」単位銀行制の受講生数は、2015年の導入当時の753人から、2016年4,738人、2017年6,329人、2018年7,829人と、毎年増加している。

2学期の一般人を対象にしたコースには、「知的財産概論」、「デザイン保護法」、「法学概論」、「自然科学概論」、「技術経営論」、「研究開発と知的財産」、「知的財産権管理論」、「インターネットと知的財産権法」など計8つの教育課程が、単位交流大学の在学学生を対象にしたコースには、「知的財産概論」、「インターネットと知的財産権法」、「特許法」など、計3つの教育課程が開設される見通しである。

「知的財産学」の専攻コースは、特許庁国際知識財産研修院知的財産学単位銀行制のウェブサイト (<http://cb.ipacademy.net>) で申し込み、2学期の教育課程は8月30日(金曜)から12月12日(木曜)まで15週間行われる。

特許庁国際知識財産研修院長は、「実用的な教育コンテンツの開発および普及に取り組み、大韓民国のイノベーション成長を導いていく未来の知的財産専門人材の育成に向けて持続的に努力する」と述べた。

2-2 大韓弁理士会、「半導体素材技術の国産化」特許戦略策定へ

電子新聞 (2019. 8. 8)

弁理士業界が素材部品の研究開発 (R&D) 関連の IP 戦略を策定して産業界と政府を側面支援する。

大韓弁理士会は、半導体素材部品の技術の国産化と関連して、源泉特許の事前分析作業を支援する「素材部品基盤技術の国産化に向けた源泉特許対策特別委員会 (源泉特許対策委)」を構成したと 8 月 8 日、明らかにした。

源泉特許分析が先決されなければ、国産化の課程で特許紛争を避けられない状況にあり、特許の確保が難しい。弁理士会は R&D 成果を最大化して、短期間で成果を創出できるように支援する計画である。

源泉特許対策委は、日本が輸出規制を強化したフッ化ポリアミド、フォトレジスト、フッ化水素関連の日本企業の源泉特許を分析して韓国企業と政府に効果的な対応方を提示する。

半導体、二次電池の分離膜、水素自動車の燃料タンクなどに使われる炭素繊維など、「ホワイト国除外」による輸出規制の影響内にある主要技術に対して源泉特許の分析を拡大していく方針である。

源泉特許対策委は、各分野別の専門弁理士 30 人～50 人が自発的に参加した。活動の結果は、9 月中のセミナーを通じて政府関係部処および産業界に無償で提供する。

大韓弁理士会長は、「技術の国産化課程において、源泉特許は地雷のようなもので、徹底した備えがないまま急いではならない」とし、「国内唯一の専門家集団として重い責任を感じており、可能な全ての支援を惜しまない」と述べた。

2-3 特許庁、「知的財産基盤世代英才企業家」10 周年記念式典開催

韓国特許庁 (2019. 8. 8)

「次世代の発明英才、一緒に歩んだ 10 年～共に描いていく夢！」

特許庁は、「知的財産基盤次世代英才企業家育成事業」の 10 周年を迎えて、これまでの成果を共有するとともに、これからの 10 年のビジョンを発表する「知的財産基盤次世代

英才企業家 10 周年記念式典」を 8 月 8 日（木曜、午前 10 時 30 分）、The-K ホテルソウル（ソウル市瑞草区）で開催すると明らかにした。

知的財産基盤次世代英才企業家育成事業は、政府イノベーションを後押しするとともに、IP 能力と企業家精神を兼ね備えた創意的で革新的な企業家を育成するために、潜在力に満ちた満 13～15 歳の生徒を選抜・育成する人材育成事業として、選抜された生徒は知的財産だけでなく創意的な問題解決方法、企業家精神、コミュニケーション方法などの教育を 2 年間受けることができる。

教育を受ける生徒の年齢が若いにもかかわらず、過去 10 年間で出願した知的財産権は 2,981 件に達しており、スタートアップ創業 36 件、大韓民国人材賞 33 名受賞などの成果を出している。

また、理工系離れの現実の中、修了者の理工系進学率が 77.4%と高い割合となっている。

「次世代の発明英才、一緒に歩んだ 10 年～共に描いていく夢！」のスローガンで開かれる 10 周年記念式典では、知的財産基盤次世代英才企業家事業における今後のビジョンの発表のほか、「偽物の人材と本物の人材」というテーマで高麗大学のチョウ・ビョク碩座教授による特講や、知的財産基盤次世代英才企業家教育・修了者から教育の感想を聴く場も設けられる。

記念式典後のセッション別のイベントでは、知的財産基盤次世代英才企業家教育に関心のある生徒と親のために、KAIST・POSTECH 英才企業家教育院で実際、遂行したプログラムを直接体験することができる教育の機会を設けており、アクセラレーターと共同で行う創業・投資メンタリング、知的財産基盤次世代英才企業家教育の成果共有など、今後の教育方向について討論する創意発明教育カンファレンスも開催される。

特許庁長は、「知的財産基盤次世代英才企業家たちが、遠くない未来にグローバル・イノベーションリーダーとして成長して、大韓民国の持続可能な成長エンジンを創出するだろう」とし、「特許庁は、才能のある青少年たちが未来のイノベーションを主導する人材として成長できるように、より一層 IP 基盤の融合教育に取り組む」と述べた。

2-4 強い知的財産の創出、私たちに任せてください！

韓国特許庁 (2019. 8. 12)

特許庁、2019 年上半期優秀審査官、審判官選定

特許庁は、8 月 12 日（月曜、午後 1 時 30 分）政府大田庁舎大会議室で、高品質の審査で強い知的財産の創出に貢献した優秀審査官などを選定して授賞する。

最優秀審査官には、ユ・サムソク審査官（商標デザイン審査局）、イ・フンジェ審査官（特許審査企画局）、イム・ヨンフン審査官（特許審査 1 局）、クァク・ジュホ審査官（特許審査 2 局）、イ・ヨンジュ審査官（特許審査 3 局）が選定され、最優秀審判官には、キム・ドンヨプ審判官（審判 8 部）が選定された。

具体的な授賞内容は、審査分野で (1) 優秀審査官 40 人（最優秀審査官含む）、(2) 優秀審査特許チーム長 25 人、(3) 能力増進優秀審査官 8 人、(4) 10 の優秀審査部署を選定しており、審判分野は、(5) 優秀審判官 6 人（最優秀審判官含む）、(6) 優秀訴訟遂行官 1 人、(7) 2 つの優秀審判部を選定した。

優秀審査官は、審査課長および特許チーム長による審査品質の点検の結果、各種審査品質の指標および品質向上への努力度を反映して、審査品質競演大会を通じて選定された。

特許庁長は、「最近、日韓の貿易対立が高まる中で、産業競争力の確保において知的財産の重要性が日増しに強調されている」とし、「イノベーション創業と雇用につながる強い知的財産は、審査官の努力によって創出されるという誇りを持って審査品質の向上に最善を尽くしてほしい」と述べた。

2-5 イノベーション成長の達成に向けて革新的特許の発掘、アイデア取引の支援など

韓国特許庁 (2019. 8. 12)

特許庁は、8 月 12 日（月曜、午前 11 時）、ベンチャー型組織 2 課（特許事業化担当官、アイデア取引担当官）の新設を記念する発足式を開催し、革新的特許の発掘およびアイデア取引関連の政府イノベーション業務に本格的に取り組むと明らかにした。

特許庁は、6 月 11 日の行政安全部主管の 10 の最終課題を選定するベンチャー型組織アイデア大会において 1 位と 5 位を占め、政府部処で唯一、2 課題が選定された。その後、ベンチャー型組織の設立・運営に向けて順調に準備を行ってきた。

7月には、職員の公募および事務空間の確保を完了し、8月には特許庁ベンチャー型組織を新設する内容の特許庁職制施行規則の改正を完了するなど、特許庁ベンチャー型組織は、8月12日からの施行に伴い運営にかかわる諸基盤を整備した。

今回新設される特許事業化担当官およびアイデア取引担当官は、特許庁長の直属として課長を含めて5～6人の少数精鋭体制で設置され、2年間臨時的に運営された後、成果次第で存続の有無が決まる。

特許事業化担当官は、人工知能、モノのインターネットなどイノベーション成長エンジン分野のスタートアップが保有する特許の中から、技術性と事業性のある「革新的特許」を発掘して、投資連携および技術創業の成功に向けて支援する。

アイデア取引担当官は、QRコードで製品に含まれた特許、デザイン、商標などの知的財産の情報を消費者に提供するとともに、消費者と企業がアイデアを直接取引できるプラットフォームを開発・運営する。

特許庁長は、「革新的特許の発掘とアイデア取引の活性化が、韓国のイノベーション成長の土台になるだろう」と期待を示し、「特許庁のベンチャー型組織がきちんと成果を出し、政府の革新的な挑戦が成功するよう、最善を尽くす」と述べた。

2-6 特許庁長、半導体設備の中核部品製造企業を訪問

韓国特許庁 (2019. 8. 12)

特許庁長は、8月12日(月曜)、忠清南道牙山(アサン)市に所在する、半導体設備部品の製造企業である(株)ポイントエンジニアリングを訪問して、日本の輸出規制に対する現場の意見を聴取する時間を設ける。

現場訪問概要

- (1) 日時/場所：8月12日(月曜) 16:30～18:00、(株)ポイントエンジニアリング
- (2) 参加者：(特許庁)庁長、産業財産創出戦略チーム長など
(ポイントエンジニアリング)代表など役職員
- (3) 内容：隘路事項聴取、素材・部品企業のための支援策の模索など

今回の訪問は、韓国の中小企業の素材・部品の競争力を強化するために、半導体設備の部品分野で優秀な技術力を保有する強小企業の意見を聴取して効果的な支援対策を模索するために設けられた。

(株) ポイントエンジニアリングは、特許庁の IP 連携研究開発 (IP-R&D) (※) の戦略支援事業を通して、半導体設備の中核素材である陽極酸化アルミニウム (※※) (AAO) の慢性的な問題を解消した新しい AAO 素材を開発して製品化に成功した。

※IP 連携研究開発 (IP-R&D) : 特許 (IP) 分析を基盤に、最適な R&D の方向と優秀な特許確保戦略を支援する特許戦略コンサルティング

※※陽極酸化アルミニウム (AAO : Anodic Aluminum Oxide) : 軽度、絶縁性などを高めるために表面を人工的に酸化処理したアルミニウム基板

このような技術力を基に、(株) ポイントエンジニアリングは、グローバル半導体設備企業から独占納品契約と投資誘致に成功しており、売上も 2 倍以上成長するなど、素晴らしい成果を挙げている。また、2019 年は KOSDAQ (コスダック) にも成功的に上場した。

最近では、プローブカード (※) など、国内の対日依存度が高い半導体の中核素材・部品に対する開発も行われており、今後、関連市場での善戦が期待されている。

※半導体の動作を検査するために、半導体チップとテスト設備をつなげる装置 (プローブカードに装着されているプローブの針がウェーハと接触しながら電気を送り、その時に帰ってくる信号で半導体チップの不良を選別する)

特許庁は、3 大素材に対する日本の輸出規制措置の発表以降、対日輸出規制対応タスクフォース (TF) を構成して、早期の技術開発を通して国産化が急がれる中核品目に対する特許分析を支援するなど、関連部処と緊密に協力して輸出規制に対応している。

また、8 月 5 日に発表された政府対策の「素材・部品・設備競争力強化対策」に基づいて、素材・部品・設備分野の戦略品目に対して、代替技術の確保に向けた IP 連携研究開発の戦略支援を拡大していく計画である。

特許庁長は、「素材・部品・設備分野において、日本などの先導国が構築した特許の障壁を克服し、独自の技術開発によって技術大国を実現するためには、必ず、特許ビッグデータの分析による綿密な研究開発の戦略策定が先行されなければならない」とし、「韓国をホワイト国から除外した日本の措置に対応して、韓国企業の知財権関連の隘路事項の把握、支援方策の整備、関係部処との協力および協業などを通して、代替技術の開発と新技術の確保を支障なく推進する」と述べた。

日本が韓国に対して輸出規制を行っている半導体 3 大素材の特許占有率をみると、世界の半数程度を日本が占めていることが判明した。中核技術を知的財産として保護する戦略を取っており、これは、韓国の技術自立化の課程において「地雷」として作用しかねないとの憂慮がでている。これを受けて、対外依存度が高い技術を確保する前に、特許関連の紛争を回避して、進入が容易な産業を選別する戦略策定が先行されるべきという指摘がある。

8 月 12 日、大韓民国世界特許 (IP) ハブ国家推進委員会が国会で開催した「特許から見る日本の経済報復対応戦略討論会」でテーマ発表を行った特許庁産業政策財産局長は、「日本が知的財産権を先取した状況が韓国の対応をより難しくしている要因」と説明した。

特許庁産業政策財産局長は、「日本は、素材部品の関連技術とノウハウを特許で先取して営業秘密として保護するなど、知的財産権をもって独占的な市場支配力を確保している」と述べた。そして、「日本の特許先占により、代替技術の確保が難しくなっており、ライセンス中断、知財権訴訟提起などの追加攻撃が可能ということがより大きい問題」と診断した。

この日の発表によると、日本が対韓国輸出規制を行った半導体 3 大素材関連の特許占有率は、世界首位である。2019 年 7 月時点で、フォトレジストは 65.1%、フッ化水素は 33%、フッ化ポリアミドは 55.3% である。同品目の韓国の特許占有率は、それぞれ 9.1%、5%、38.4% である。フッ化ポリアミドを除くと特許の量的側面では事実上競争が難しい状態である。

素材部品関連の三極特許 (米国、欧州、日本同時登録) の登録件数においても日本が 1 万 7,391 件と、2,599 件に過ぎない韓国を大きく引き離れた。

特許庁産業政策財産局長は、「韓国は、素材部品の日本への依存度が高く、輸出規制の攻撃に脆弱なのは事実」と説明した。

また、「特許連携の技術開発 (IP-R&D) の拡大を通して、製品の競争力を強化しなければならない」とし、「核心的特許の対応方策を策定して、空白技術を模索し先取する戦略などを講じなければならない」と提案した。

同局長は、「特許ビッグデータを基盤とする未来産業の競争力確保戦略」を策定し、拡散しなければならない」と付け加えた。

発表者として出席した JUSUNG エンジニアリング会長は、知的財産の価値を認め、取引するシステムを構築する必要があると強調した。

JUSUNG エンジニアリング会長は、「一生努力して技術を開発しても、わずか 1,000 万ウオンの代価しか認められていないのが現状である」とし、「きちんと技術価値を算定して認めなければ技術イノベーションはない」と指摘した。

会長は、「不動産仲介会社のように技術と企業を仲介し、取引する技術取引所と取引士が必要である。技術奪取、故意的な特許侵害に対しては懲罰的賠償を命じるなど、技術価値を保護しなければならない」と強調した。

世界韓人知識財産専門家協会会長は、「日本の輸出規制措置は、意図的に韓国の産業に打撃を与えるためであることを勘案すれば、不公正な取引行為として判断されかねない問題」とし、「経済報復の相応措置として強制実施権を検討することもあり得る」と述べた。

世界韓人知識財産専門家協会会長は、「強制実施権は、貿易摩擦への憂慮のため、ほとんど施行されていない規定であるが、最も強力な特許権保護制度を保有する米国では反競争的な事案に対して柔軟に適用する」とし、「公正取引法上の不公正な取引行為に対して韓国企業が該当製品の国内生産のために、日本企業の特許権訴訟への憂慮なく迅速かつ適法に実施することができるように、特許権者の意思とは関係なく、国が通常実施権を許諾する制度」と説明した。

また、「日本によるグローバルバリュー・チェーンの破壊に対する相応措置として、日本の一方的な輸出規制に伴う取引中断を、具体的な不公正取引の類型として特許法に直接規定することも検討することができる」と述べた。

模倣品関連および知的財産権紛争

※今号はありません。

デザイン（意匠）、商標動向

4-1 デザイン出願登録の取り下げの場合、秘密デザイン請求料、出願公開申請料も払い戻される

国民権益委員会（2019.8.8）

デザイン登録出願関連の手数料返還基準を改善するよう、特許庁に勧告

デザイン登録出願を行った後、1ヵ月以内に取り下げる、あるいは放棄する場合、一部項目の手数料のみが払い戻される問題が改善される見通しである。

国民権益委員会（以下、国民権益委）は、出願料、優先権主張申請料だけでなく秘密デザイン請求料、出願公開申請料も払い戻されるようにする根拠を新設するよう、特許庁に勧告した。

（優先権主張申請料）先に出願した内容を基準に、6ヵ月以内にデザインを改良・発明して追加で出願すれば、出願内容を最初の出願日に遡及して認める制度

（秘密デザイン請求料）出願したデザインの登録後も、公開を望まない場合は3年の範囲内で登録デザインを秘密状態に維持する制度

（出願公開申請料）登録される前の出願中のデザインは、原則的に公開されないが、模倣行為を未然に防止するために出願中のデザインを先に公開する制度

デザイン保護法によると、デザインは物品の形状・模様・色彩またはこれらを結合したものであり、視覚を通じて美感を生み出すものを意味する。「デザイン権」は、特許・実用新案・商標権とともに、産業上の利用価値を持つ発明などに関する権利である「産業財産権」の一種である。

デザイン登録のために出願する場合、出願料のほか、必要に応じては優先権主張、秘密デザイン請求、出願公開申請による手数料を納付しなければならない。

ところが、出願後1ヵ月以内に取り下げる、あるいは放棄する場合、出願料と優先権主張申請料はデザイン保護法に基づいて払い戻されるが、秘密デザイン請求料と出願公開申請料は、類似した性質の手数料ではあるものの、返還規定がないため払い戻されなかった。

このような差別的な手数料の返還規定により、出願公開を申請した後、直ぐに取り下げても手数料が払い戻されないという不合理の改善を求める苦情も発生している。

特許路サイトにて、デザイン特許申請を進める中で、手数料の追加を認知できないまま、「デザイン公開申請」の選択項目をチェックして申し込んだ。その後、「デザイン公開申請」は基本事項ではなく、選択しなければ追加料金が発生しないことを認知して、取り下げの申請書を提出した。登録決定前の取り下げ申請書の提出で取り下げるの処理にはなったが、既に納付した出願公開手数料の返還は不可能と言われた。単純な手違いで納付した手数料を返還規定がないとして返還しない不合理を改善するよう要請する。(2019年3月、国民申聞鼓相談)

これを受けて国民権益委は、デザイン登録出願以降1ヵ月以内に出願を取り下げるか放棄する場合、手数料返還の対象に、秘密デザイン請求料と出願公開申請料を含めるように、デザイン保護法を2020年12月まで改正するよう特許庁に勧告した。

国民権益委権益改善政策局長は、「今回の制度改善を通じて、デザイン登録出願の取り下げや放棄による手数料の返還課程の不合理が解消されるものと期待される」とし、「これからも国民権益委は、政府イノベーションの一環として国民生活と密接な分野の制度の改善を、積極的に推進する計画である」と述べた。

その他一般

5-1 消費者の嗜好に合わせて進化するカプセルコーヒー

韓国特許庁 (2019. 8. 1)

源泉特許満了後、関連技術の開発が活発

2012年のスイスのN社のカプセルコーヒーの源泉特許の満了に伴い、国内で関連技術の開発が活発になっており、最近では消費者の多様なニーズに応えるために、コーヒーのブランディングの割合を調節できる技術など、多様な技術が開発されていることが分かった。

特許庁によると、カプセルコーヒーの容器は、1992年に最初の源泉特許(注1)が出願されて特許登録された後、2018年まで337件が出願されており、このうち111件が特許登録された。

特に、N社の源泉特許満了が予想された2011年から出願が急増し始めており、2010年まで89件だった出願が2011年以降、248件に増加した。

この分野の特許出願は、外国人の割合が78%（262件/337件）と高いが、内国人の出願も2010年まで12件から2011年以降63件に増えており、国内企業の市場進出の努力が反映されたためとみられる。

主な外国の出願企業は、スイスのネスレ（81件）、ドイツのカフェシステム（35件）、米国のクラフトフーズ（26件）、オランダのコーニンクレッカ（21件）などがあり、国内企業は、（株）ダイン、（株）CONVEKOREA、（株）GGM、（株）テファデジタル、（株）JARO、（株）CNN コーヒーコリアなど、中小ベンチャー企業が多数を占めている。

カプセルコーヒーの技術分野別の出願の現状をみると、カプセルコーヒーの開発初期である2000年代の半ばまでは、カプセルの構造および材料、内部のコーヒー抽出水の流動方法、カプセルの密封技術などが主に特許出願された。

しかし、カプセルコーヒー市場の急成長に伴い、消費者のニーズが多様化した2000年代の半ば以降からは、二つ以上のコーヒー豆を好みに合わせてブランディングする、抽出条件の制御技術や伝統茶の抽出技術、カプセルの偽造・変造防止技術などが特許出願されている。

<カプセルコーヒー細部技術分野別特許出願現状（1992年～2018年）>

細部技術分野	件数	割合
カプセル容器の構造および材料技術	96件	28%
カプセル内部のコーヒー抽出水の流動	81件	24%
カプセルの密封技術	49件	15%
カプセルの識別および偽造防止技術	36件	11%
内容物別の抽出条件の制御	32件	9%
その他（ポッド、ドリップコーヒーなど）	43件	13%
計	337件	100%

特許庁精密部品審査課長は、「コーヒー市場の成長と高級製品を好む傾向に合わせて、カプセルコーヒーに関する特許出願が順調に行われるだろう。これからも市場シェアを拡大するために、カプセルコーヒーに先端科学技術を適用する関連企業の努力は続くだろう」と述べた。

(注1) 1992年に出願されたカプセルコーヒーの源泉特許(「ネスプレッソ」のブランドで知られる(株)ネスレが所有する)は、2012年5月に、特許保護期間の20年が経過して消滅した。

5-2 研究開発支援の拡大・特許技術の活用が微細粉塵の解決の鍵

韓国特許庁(2019.8.7)

持続的な研究開発投資と特許出願増加とともに、微細粉塵が減少傾向に

微細粉塵関連の特許動向を分析した結果、国内の微細粉塵問題を解決するためには、工場など事業場に適用される排出低減技術の研究開発支援がより拡大される必要があり、それとともに、環境先進国の主要特許技術をベンチマーキングすることも重要な方策であると評価された。

特許庁は、8月9日(金曜)、微細粉塵関連の特許動向分析および主要技術の分析結果を発表する。

今回の調査は、最近、深刻な微細粉塵問題を技術的に解決する方策を模索するために推進されたもので、過去20年間(1999年~2018年)で、韓国、米国、欧州、中国、日本で公開された微細粉塵関連の9万件余りの特許を分析して特許動向および先進国の対応戦略を調査した。

調査の結果、微細粉塵の全体的出願件数は、中国が42,266件(46%)で1位を占めており、日本(18,496件、20%)、韓国(13,697件、15%)、米国(11,522件、12%)、欧州(6,098件、7%)の順であった。

韓国と中国では、最近、微細粉塵に対する憂慮が高まる中、2013年以降出願件数が急増した反面、既に米国、欧州、日本では深刻な大気汚染問題の経験から、1960年代以前から持続的に技術開発が行われており、最近では微細粉塵問題が大部分解決されており、特許出願も減少または停滞する現象をみせている。

出願技術分野は、工場、車両などから出る微細粉塵の排出を低減する技術が45%と最も多く、空気洗浄機など国民生活の保護技術が31%、測定・分析技術が24%を占めた。

先進国の場合、海外市場の拡大という目的から、排出低減技術(47%~58%)と測定・分析技術(27~37%)分野の出願の割合が高い反面、韓国では微細粉塵問題の深刻性お

よび空気洗浄機の人気に支えられ、国民生活保護技術の出願の割合（41%）が高くなっている。

今回の調査結果で注目すべき点は、韓国と中国の微細粉塵関連の特許出願が増加するにつれて、両国の微細粉塵濃度が持続的に減少しているということである。

微細粉塵問題の深刻性を受けて、韓・中両国は大気汚染物質の排出基準の強化とともに、微細粉塵対応技術の研究開発に投資を拡大しており、その結果、特許出願は大きく増加していることと調査された。

このような特許出願件数の増加および排出基準の強化の努力により、微細粉塵の濃度は徐々に減少されている傾向となっている。

一方、今回の分析結果、韓国では車両などの運送手段用の微細粉塵排出低減技術が多数（3,292件、57%）を占めるのに対して、事業場用の微細粉塵低減技術の出願の割合（2,507件、43%）は低いことが判明した。国内の微細粉塵は産業施設、発電所などの事業場で多く発生（72%）している点を勘案すれば、これからの政府の研究開発支援は事業場用の微細粉塵低減技術開発により集中しなければならないものとみられる。

また、特許庁は今回の調査を通して、過去30年間の主要国の特許出願の中から、微細粉塵の解決に必須的な核心的特許技術を掘り起し、国内で活用の可能性が高い275件を選別して8月9日（金曜）の発表会で公開する予定である。

主要特許275件の中には、国内に特許出願されていなかったり、特許期間が満了して活用可能なものが226件（82%）に達した。

また、主要特許の中には、微細粉塵・硫黄酸化物の同時除去用の電気集塵機、洗浄水の上向き噴霧方式の硫黄酸化物除去装置などといった実際、海外の現場に適用された事例も含まれており、微細粉塵の解決には新技術の開発だけでなく、先進国の既存の技術のベンチマーキングも重要であると評価される。

今回の発表会を通して、微細粉塵低減技術の開発に関心のある企業、研究所および公共機関は、主要先進国の微細粉塵対応技術の特許情報を得ることができるとともに、企業は先進国の技術開発の結果物をベンチマーキングして、研究開発戦略の策定費用と期間を大幅に短縮することができると期待される。

特許庁特許審査2局長は、「微細粉塵の解決に向けた技術は、早くから特許出願されており、国内でも新技術開発に積極的ではあるが、大型の排出事業場では新技術の導入に消極的な傾向がある」とし、「政府から、新技術をテストする試験場を既存の事業場または新規の排出事業場に新設できるように支援が行われれば、企業の技術開発の促進と事業化にもつながるだろう」と述べた。

5-3 未来自動車の核心、AIカメラ技術

韓国特許庁 (2019. 8. 12)

車両用の映像認識分野の特許出願急増

ディープラーニングといったAI技術の発展に伴い、自律走行車の時代が遠くない未来に現実になる。これを可能にする中核技術としてAI映像認識が大きく注目を集めている。映像認識技術は、カメラを通して収集された情報を利用してAIが車両周辺の物体を感知して、その種類と意味を理解した上で多様な作動を提供する技術である。

最近まで、自律走行技術は技術進入の障壁が高く、長期的な投資と技術開発能力を確保した巨大ICT企業や自動車産業内の少数の企業が自律走行技術の開発を主導してきた。しかし、ここ3~4年でシリコンバレーを中心に映像認識技術を活用した自律走行技術を具現する企業が出現し、これまで高かった技術進入の障壁が早いスピードで崩れており、国内の中小企業の参加も活発に行われている。

特許庁によると、車両用の映像認識技術関連の特許出願が順調に続いており、特に中小企業の出願が2016年から急激に増加していると明らかにした。

車両用の映像認識技術関連の特許出願は、2010年は79件に過ぎなかったが、2013年に276件と3倍以上大きく増加しており、2014年以降、毎年平均215件が出願されるなど、関連する出願が順調に行われており、中小企業の場合、2014年の35件から2018年は98件と、年平均約29%増加したことが分かった。

車両用の映像認識技術は、最近、自律走行車市場の持続的な成長とディープラーニング技術が相まって発展する分野であるため、中小企業の市場参入が相対的に容易であり、今後もこのような出願傾向は持続されると予想される。

過去10年間(2010年~2019年6月)の出願人別の出願動向をみると、大企業534件(30%)、中小企業404件(22%)、大学332件(18%)、研究機関138件(8%)の順であったが、

直近5年間は、大企業266件(28%)、中小企業252件(26%)、大学184件(19%)、研究機関68件(7%)の順と調査された。ここで注目すべき点は、大企業に比べて中小企業の出願の割合が最近高くなっているが、これは、初期は主に大企業で車両用の映像認識技術開発を主導してきたが、最近は中小企業の市場参入が増加して、技術開発とこれに伴う出願が増加したためと分析される。

また、技術分野別の出願動向をみると、客体の検出・認識および追跡技術が41%と最も高くなっており、その次を映像劣化およびカメラ歪曲を補正する前処理技術(16%)、アラウンドビューおよびパーキングアシスト技術(12%)が占めている。これは客体の検出と識別、追跡の正確度を高めるための技術が車両用の映像認識分野において最も重要な部分であることを意味する。

特許庁マルチメディア放送審査チーム長は、「車両用の映像認識技術は、小規模の人員と低費用で開発できるという点から中小企業が強みを持つことができる分野である。実際に中小企業の車両用の映像認識技術関連の出願件数は、大企業とで格差が縮まっている傾向にあり、ここ3年間で特許出願が急激に増加した」とし、「今後、関連産業の発展および雇用増大に貢献するものと期待されるだけに、中小企業が競争力を高めるためには、事前に特許戦略を策定して技術開発を行うことが何より重要である」と述べた。

一方、特許庁では、優秀技術を保有する企業の特許創出能力を強化するために、特許権と連携した第四次産業革命技術の研究開発戦略の策定を支援しており、特に海外進出の支援として海外市場別のオーダーメイド型知的財産戦略を持続的に提供している。

過去のニュースは、<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/ipnews/archive.html> をご覧下さい。

お問い合わせ、ご意見、ご希望は、ジェトロソウル事務所 知財チーム(電話:02-739-8657/FAX:02-739-4658 e-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp)までお願いします。

本ニュースレターの新規配信につきましては、お手数ですが下記のURLにアクセスして、ご自身でご登録いただけますようお願いいたします。

https://www.jetro.go.jp/mreg2/magRegist/index.htm?mag_id=3665

本ニュースレターの著作権はジェトロに帰属します。本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

ジェトロはご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行なってください。

本文を通じて皆様に提供した情報の利用(本文中からリンクされているWebサイトの利用を含みます)により、不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロはその責任を負いません。

発行:ジェトロソウル事務所 知財チーム